



(Korea)

## EV Group announces next-generation nanoimprint lithography system EVG770 NT - June 9, 2021

EVG announced the EVG®770 NT—its next-generation step-and-repeat NIL system. The EVG770 NT enables precise replication of micro- and nano-patterns for large-area master stamp fabrication used in high-volume manufacturing of AR waveguides, WLO and advanced lab-on-a-chip devices. It provides industry-leading overlay accuracy and resolution with scalability up to 300-mm-wafer and Gen-2-panel sizes. As a result, customers can now realize the promise of high-volume, cost-efficient and high-fidelity NIL patterning.

전자신문 Conference allshowTV ETedu English

통신&방송 SW&게임&성장기업 소재&부품 전자&자동차&유류 경제&금융 산업&과학&정책

### EV그룹, 차세대 나노임프린트 리소그래피 'EVG770NT' 출시

발행일 : 2021.06.09



[올쇼TV] 최적의 장비를 디자인 할 수 있는 솔루션 (6/15 생방송)



<EVG 770 NT>

EV그룹은 차세대 나노임프린트 리소그래피 장비 'EVG 770 NT'를 출시했다고 9일 밝혔다.  
EVG770NT는 스핀-앤드-리프트 방식으로 기존 장비 대비 생산성을 크게 높였다.

신제품은 마이크로나노 패턴을 정밀하게 복제할 수 있다. 증강현실(AR) 웨이브 가이드, 웨이퍼 레벨 광학소자(WLC), 최첨단 랩온어칩(Advanced Lab-on-a-chip) 기기를 양산하는데 유리하다.

EVG770NT는 성능과 생산성, 공정 제어 능력을 극대화할 수 있는 시스템으로 설계됐다. 기존 대면적 정밀 마스터 스템프를 구할 수 없어 나노임프린트 리소그래피 공정을 확장할 수 없었던 한계를 극복했다. 이 장비로는 최대 300mm 웨이퍼와 2세대 패널 크기까지 확장할 수 있다.

보다 큰 기판 위에 대형 마스터플드(주형)를 복제할 수 있기 때문에 많은 기기를 동시에 생산할 수 있다. 다이아몬드 드릴링, 레이저 직접 쓰기, 전자 빔 쓰기 등 기존 공정 대비 높은 수율을 확보할 수 있다. 비용 절감도 가능하다.

토마스 글린스너 EV그룹 기술 디렉터는 "EVG770NT는 마이크로 광학 소자 형성이나 나노 패터닝을 비용 효율적으로 대량 생산할 수 있다"고 밝혔다.

<https://www.etnews.com/20210609000146>